

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第5区分

【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公開番号】特開2015-209625(P2015-209625A)

【公開日】平成27年11月24日(2015.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2015-073

【出願番号】特願2014-94284(P2014-94284)

【国際特許分類】

A 41 D 19/015 (2006.01)

A 41 D 19/00 (2006.01)

A 41 D 19/04 (2006.01)

【F I】

A 41 D 19/015 210 A

A 41 D 19/00 P

A 41 D 19/04 B

【手続補正書】

【提出日】平成29年4月6日(2017.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

一方、比較例1～3は、ゴム粉2として粒径が250μmの機械粉碎されたゴム粉末を用いており、共通の構成にしている。比較例1，2，4は、滑り止め層12のポリ塩化ビニル100重量部に対する可塑剤の配合量を40重量部にしており、共通の構成にしている。

比較例1は、ベース層用のポリ塩化ビニル系ペーストに成形型Bを全体的に浸漬することで、成形型Bの表面に沿ってベース層11が浸漬成形され、ベース層11が乾燥した後に、多数のゴム粉2が分散して配合された滑り止め層用のポリ塩化ビニル系ペーストに、ベース層11が浸漬成形された成形型Bを部分的に浸漬することで、ベース層11の表面に沿って滑り止め層12を部分的に積層している。それにより、ゴム粉2が手袋本体1の滑り止め層12の表面から突出して配置される。成形後は成形型Bから正転離型して完成品を得るところが異なっている。

比較例2は、比較例1と同様に正転離型して完成品を得ることは共通しているが、ゴム粉2が配合されない滑り止め層用のポリ塩化ビニル系ペーストを用い、ベース層11の表面に沿って積層される滑り止め層12を部分的に浸漬成形した直後、半ゲル状態の滑り止め層12の表面に多数のゴム粉2を散布して分散配置している。それにより、ゴム粉2が手袋本体1の滑り止め層12の表面から突出しているところが異なっている。

比較例3では、滑り止め層12のポリ塩化ビニル100重量部に対する可塑剤の配合量を20重量部にしたところが異なっている。

比較例4では、ゴム粉2として粒径が450μmの機械粉碎されたゴム粉末を用いており、ゴム粉2が手袋本体1の滑り止め層12の表面から突出しているところが異なっている。

比較例5では、実施例5と共通しているものの、滑り止め層12にゴム粉2を配置していないところが異なっている。つまり、比較例5の滑り止め層12は、ゴム粉2が配合されない滑り止め層用のポリ塩化ビニル系ペーストに成形型Bを部分的に浸漬することで浸漬成形されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

【表2】

		比較例				
		1 塩ビ中に分散配合	2 浸漬成形直後の散布	3 塩ビ中に分散配合	4 塩ビ中に分散配合	5 ゴム粉なし
ゴム粉の形成方法						
手袋本体の浸漬成形方法	正転離型	正転離型	反転離型	反転離型	反転離型	
手袋本体の表面におけるゴム粉の形状	突出	突出	平滑	平滑		
ゴム粉の粒径(μm)	250	250	250	450		
ベース層	ポリ塩化ビニルに対する可塑剤の配合量(重量部)	100	100	100	100	100
滑り止め層	ポリ塩化ビニルに対する可塑剤の配合量(重量部)	40	40	20	40	60
評価結果	ゴム粉の脱落性	×	×	○	○	
	グリップ性	○	○	○	○	△
	成形性	○	○	×	×	○
	柔軟性	◎	◎	×	◎	◎